# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-237140

(43)Date of publication of application: 31.08.2001

(51)Int.CI.

H01G 4/12 1/16

CO4B 35/622 H01F 17/00

H01F 41/04 H016 4/30

(21)Application number: 2000-319521 (22)Date of filing:

19.10.2000

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD (72)Inventor: MIYAZAKI MAKOTO

TANAKA SATORU

(30)Priority

Priority number: 11352634

Priority date: 13.12.1999

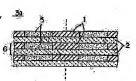
Priority country: JP

### (54) LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND ITS MANUFACTURING METHOD AND CERAMIC PASTE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide ceramic paste in which the distributing properties of ceramic powder contained in the paste is improved.

SOLUTION: To manufacture ceramic paste, a primary distribution process for distributed-processing a primary mixture containing at least ceramic powder and the first organic solvent and a secondary distributing process for distributed- processing a secondary mixture in which at least an organic binder is added to the primary mixture, are performed. The primary mixture and/or the secondary mixture comprise the second organic solvent having a relative evaporation rate smaller than the first organic solvent. The first organic solvent is removed selectively by thermally treating the secondary mixture after the secondary distribution process. The ceramic paste is used advantageously for forming ceramic green layers 5 for absorbing stepped sections on the main surfaces of ceramic green sheets 2 so as to substantially remove the stepped sections by the thickness of internal electrodes 1 in a laminated ceramic capacitor.



LEGAL STATUS

Date of request for examination

02.07.2002 22 07 2003

rejection

[Date of sending the examiner's decision of

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-237140 (P2001-237140A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			Ŧ	-73-1 (参考)
H01G	4/12	364		H01G	4/12		364	
		349					349	
B28C	1/16			B 2 8 C	1/16			
	7/02				7/02			
C04B	35/495			H01F	17/00		D	
			審查請求	未請求 請求	求項の数15	ol	(全 17 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特顧2000-319521(P2000-319521)

(22)出廣日 平成12年10月19日(2000.10.19)

(31)優先権主張番号 特願平11-352634 (32)優先日 平成11年12月13日(1999,12.13)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出額人 000006231 株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 宮崎 信

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内 (72)発明者 田中 覧

> 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内

(74)代理人 100085143

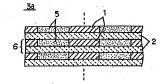
弁理士 小柴 雅昭

(54)【発明の名称】 積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 そこに含まれるセラミック粉末の分散性が高 められたセラミックペーストを提供する。

【解決手段】 セラミックペーストを製造するため、少なくともモラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分飲工程と1次混合物を分散処理する2次分散工程と大混合物はよび/または、第1の有機溶剤と含めましび/または、第1の有機溶剤を含んでいる。そして、2次分散工程の後、2次混合物を強力がに除去する。このセラミックペーストは、たとえば開催セラミックコンデンサにおける内部電 届1の厚みによる段差を実質的になくすようたセラミックグリーン型のと形成するために有利に用いられる。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスラリー、導電性ベーストお よびセラミックペーストをそれぞれ用意し、

前記セラミックスラリーを成形することによって得られ たセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリー ンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすよう に部分的に前記選電性ペーストを付与することによって 形成された内部回路要素膜と、前記内部回路要素膜の厚 みによる段差を実質的になくすように前記セラミックグ リーンシートの前記主面上であって前記内部回路要素膜 10 が形成されない領域に前記セラミックペーストを付与す ることによって形成された段差吸収用セラミックグリー ン層とを備える、複数の複合構造物を作製し、

複数の前記複合構造物を積み重ねるととによって、生の 積層体を作製し.

前記牛の糟層体を焼成する、各工程を備える、糟層型セ ラミック電子部品の製造方法であって.

前記セラミックペーストを用意する工程は、

心かくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1 次混合物を分散処理する1次分散工程と、

前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有 機パインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散 T程と

前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有 機溶剤を前記1次混合物および/または前記2次混合物 に含ませる工程と.

前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理する ことによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する 除去工程とを備える。精層型セラミック電子部品の製造 方法。

【請求項2】 前記1次分散工程において、前記1次混 合物は有機分散剤を含む、請求項1に記載の精層型セラ ミック電子部品の製造方法。

「請求項3 】 前記第1の有機溶剤の20℃における相 対蒸発速度は、100以上であり、前記第2の有機溶剤 の20℃における相対蒸発速度は、50以下である。請 求項1または2 に記載の積層型セラミック電子部品の製 造方法。

【請求項4】 前記セラミックペーストを用意する工程 は、前記2次分散工程の後であって、前記除去工程の前 40 に、前記2次混合物を濾過する工程をさらに備える、請 求項1ないし3のいずれかに記載の積層型セラミック電 子部品の製造方法。

【請求項5】 前記セラミックペーストを用意する工程 は、前記有機パインダを前記第1の有機溶剤および/ま たは前記第2の有機溶剤に溶解することによって、有機 ビヒクルを作製する工程と、前記有機ビヒクルを濾過す る工程とをさらに備え、前記2次混合物は、前記濾過工 稈を経た前記有機ビヒクルの状態で加えられた前記有機 バインダを含んでいる。請求項1ないし4のいずれかに 50 【0001】

記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項6】 前記第1の有機溶剤は、前記第2の有機 ※割より低い沸点を有する。請求項1ないし5のいずれ かに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項7】 前記第1の有機溶剤の沸点と前記第2の 有機溶剤の沸点との差は、50°C以上である、請求項6 に記載の精層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項8】 前記セラミックスラリーは、前記セラミ ックペーストに含まれる前記セラミック粉末と実質的に 同じ組成を有するセラミック粉末を含む、請求項1ない し7のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製 造方法。

【請求項9】 前記セラミックスラリーおよび前記セラ ミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、 ともに、誘電体セラミック粉末である。請求項1ないし 8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造 方法.

【請求項10】 前記内部回路要素膜は、互いの間に静 電容量を形成するように配置される内部電極であり、前 20 記積層型セラミック電子部品は、積層セラミックコンデ ンサである、請求項9に記載の積層型セラミック電子部 品の製造方法。

【請求項11】 前記セラミックスラリーおよび前記セ ラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末 は、ともに、磁性体セラミック粉末である、請求項1な いし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の 製造方法。

【請求項12】 前記内部回路要素膜は、コイル状に延 びるコイル導体膜であり、前記積層型セラミック電子部

30 品は、積層インダクタである、請求項11に記載の積層 型セラミック電子部品の製造方法。 【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに記載

の製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部

【請求項14】 少なくともセラミック粉末と第1の有 機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程

前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有 機パインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散

前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有 機溶剤を前記1次混合物および/または前記2次混合物 に含ませる工程と、

前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理する ことによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する 除去工程を備える、セラミックペーストの製造方法。 【請求項15】 請求項14に記載の製造方法によって 得られた、セラミックペースト。 【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】との発明は、積層型セラミッ ク電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペー ストおよびその製造方法に関するもので、特に、セラミ ック層間に形成される内部回路要素膜の厚みに起因する 段差を吸収するために内部同路要素膜パターンのネガテ ィブパターンをもって形成された段差吸収用セラミック 層を備える、積層型セラミック電子部品およびその製造 方法、ならびに、段差吸収用セラミック層を形成するの に有利に用いられるセラミックペーストおよびその製造 方法に関するものである。

### [0002]

【従来の技術】たとえば積層セラミックコンデンサのよ うな積層型セラミック電子部品を製造しようとすると き、複数のセラミックグリーンシートが用意され、これ らセラミックグリーンシートが積み重ねられる。特定の セラミックグリーンシート上には、得ようとする積層型 セラミック電子部品の機能に応じて、コンデンサ、抵 抗、インダクタ、バリスタ、フィルタ等を構成するため の導体膜、抵抗体膜のような内部回路要素膜が形成され

【0003】近年、移動体通信機器をはじめとする電子 機器は、小型化かつ軽量化が進み、このような電子機器 において、たとえば積層型セラミック電子部品が同路素 子として用いられる場合、このような精層型セラミック 電子部品に対しても、小型化および軽量化が強く要求さ れるようになっている。たとえば、積層セラミックコン デンサの場合には、小型化かつ大容量化の要求が高まっ ている。

【0004】積層セラミックコンデンサを製造しようと する場合、典型的には、誘電体セラミック粉末、有機パ 30 インダ、可塑剤および有機溶剤を混合してセラミックス ラリーを作製し、このセラミックスラリーを、剥離剤と してのシリコーン樹脂等によってコーティングされた。 たとえばポリエステルフィルムのような支持体上で、ド クターブレード法等を適用して、たとえば厚さ数10μ mのシート状となるように成形することによって、セラ ミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミ ックグリーンシートが乾燥される。

【0005】次に、上述したセラミックグリーンシート の主面上に、互いに間隔を隔てた複数のバターンをもっ 40 て、導電性ペーストをスクリーン印刷によって付与し、 これを乾燥することにより、内部同路要素膜としての内 部電極がセラミックグリーンシート上に形成される。図 7には、上述のように複数箇所に分布して内部電極1が 形成されたセラミックグリーンシート2の一部が平面図 で示されている。

【0006】次に、セラミックグリーンシート2が支持 体から剥離され、適当な大きさに切断された後、図6に 一部を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられ、さら に、この積み重ねの上下に内部電極を形成していないセ 50 図3に示すように、得られた積層体チップ4gにおい

ラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積み重ねられ るととによって、生の積層体3が作製される。

【0007】との生の積層体3は、積層方向にプレスさ れた後、図8に示すように、個々の積層セラミックコン デンサのための積層体チップ4となるべき大きさに切断 され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付 され、最終的に外部電極が形成されるととによって、積 層セラミックコンデンサが完成される。 【0008】とのような積層セラミックコンデンサにお

10 いて、その小型化かつ大容量化に対する要求を満足させ るためには、セラミックグリーンシート2 および内部電 極1の積層数の増大およびセラミックグリーンシート2 の護層化を図るととが必要となってくる。

【0009】しかしながら、上述のような多層化および 薄層化が進めば進むほど、内部電極1の各厚みの累積の 結果、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との 間、あるいは、内部電極1が積層方向に比較的多数配列 されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が より顕著になり、たとえば、図8に示すように、得られ た積層体チップ4の外観に関しては、その一方主面が凸 状となるような変形が生じてしまう。

【0010】積層体チップ4において図8に示すような 変形が生じていると、内部電極1が位置していない部分 あるいは比較的少数の内部電極1しか精層方向に配列さ れていない部分においては、プレス工程の際に比較的大 きな歪みがもたらされており、また、セラミックグリー ンシート2間の密着性が劣っているため、焼成時に引き 起とされる内部ストレスによって、デラミネーションや 微小クラック等の構造欠陥が発生しやすい。

【0011】また、図8に示すような積層体チップ4の 変形は、内部電極1を不所望に変形させる結果を招き、 これによって、ショート不良が生じることがある。 【0012】 このような不都合は、精層セラミックコン

デンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0013】上述のような問題を解決するため、たとえ ば、図2に示すように、セラミックグリーンシート2上 の内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セ ラミックグリーン層5を形成し、この段差吸収用セラミ ックグリーン層5によって、セラミックグリーンシート 2上での内部電極1の厚みによる段差を実質的になくす ととが、たとえば、特開昭56-94719号公報、特 開平3-74820号公報、特開平9-106925号

【0014】上述のように、段差吸収用セラミックグリ ーン層5を形成することによって、図1に一部を示すよ うに、生の積層体3 a を作製したとき、内部電極1が位 置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極 1 が積層方向に比較的多数配列されている部分とそろで ない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、

公報等に記載されている。

て、図8に示すような不所望な変形が生じにくくなる。 【0015】その結果、前述したようなデラミネーショ ンや微小クラック等の構造欠陥および内部電極1の変形 によるショート不良といった問題を生じにくくすること ができ、得られた積層セラミックコンデンサの信頼性を 高めるととができる。

#### [0016]

[発明が解決しようとする課題]上述した段差吸収用セ ラミックグリーン層5は、セラミックグリーンシート2 の場合と同様の組成を有し、誘電体セラミック粉末、有 10 機パインダ、可塑剤および有機溶剤を含むセラミックベ ーストを付与することによって形成されるが、たとえば 厚み2μm以下といった内部電極1と同程度の厚みを有 するように、段差吸収用セラミックグリーン層5を高精 度に印刷等によって形成するためには、セラッミクペー スト中におけるセラミック粉末の分散性を優れたものと しなければならない。

[0017] これに関連して、たとえば特開平3-74 820号公報では、セラミックペーストを得るため、3 本ロールによる分散処理が開示されているが、このよう 20 な単なる3本ロールによる分散処理では、上述したよう な優れた分散性を得ることが困難である。

[0018]他方、特開平9-106925号公報で は、セラミックグリーンシート2のためのセラミックス ラリーを、誘電体セラミック粉末と有機パインダと低沸 点の第1の有機溶剤とを混合することにより作製し、こ れをセラミックグリーンシート2の成形のために用いる とともに、このセラミックスラリーに対して、上述の第 1の有機溶剤の沸点より高沸点の第2の有機溶剤を加え て混合した後、加熱し、低沸点の第1の有機溶剤を高沸 30 点の第2の有機溶剤に置換することにより、段差吸収用 セラミックグリーン層ちのためのセラミックペーストを 作製することが記載されている。

[0019]したがって、上述したようにして得られた セラミックペーストにおいては、少なくとも2回の混合 工程が実施されるので、セラミック粉末の分散性はある 程度改善されるが、とれらの混合工程では、いずれも、 有機バインダを含んだ状態で実施されるため、混合時の スラリーまたはベーストの粘度は高く、たとえばボール ミルのようなメディアを使った分散処理機では、セラミ 40 ック粉末の分散性を優れたものとすることには限界があ る。

[0020] このように、内部電極1の厚みと同等の厚 みを有する段差吸収用セラミックグリーン層5といった 極めて薄いセラミック層を形成するために用いるセラミ ックペーストとしては、そこに含まれるセラミック粉末 に関して優れた分散性が要求され、このような優れた分 散性に対する要求は、内部電極1の厚みが薄くなるほど 厳しくなる。

【0021】また、段差吸収用セラミックグリーン層5 50

におけるセラミック粉末の分散性が仮に悪い場合であっ ても、その上に重ねられるセラミックグリーンシート2 によって、分散性の悪さをある程度カバーできることも あるが、セラミックグリーンシート2の厚みが薄くなる と、このようなセラミックグリーンシート2によって分 散性をカバーする効果をほとんど期待することができな

【0022】以上のことから、積層セラミックコンデン サの小型化かつ大容量化が進むほど、段差吸収用セラミ ックグリーン層5におけるセラミック粉末に関してより 高い分散性が必要となってくる。

【0023】なお、混合工程におけるセラミック粉末の 分散効率を高めるため、セラミックペーストの粘度を低 くすることが考えられるが、このように粘度を低くする ため、前述した低沸点の有機溶剤の添加量を増すと、分 散処理後において、この低沸点の有機溶剤を除去するた め、長時間必要とするという別の問題に遭遇する。

【0024】以上、積層セラミックコンデンサに関連し て説明を行なったが、同様の問題は、積層セラミックコ ンデンサ以外のたとえば積層インダクタといった他の積 層型セラミック電子部品においても遭遇する。

【00251そとで、この発明の目的は、上述したよう な問題を解決し得る、積層型セラミック電子部品の製造 方法およびこの製造方法によって得られた積層型セラミ ック電子部品を提供しようとすることである。

[0026] この発明の他の目的は、前述した段差吸収 用セラミック層のように極めて薄いセラミックグリーン 層を形成するのに適したセラミックペーストを製造する 方法およびこの製造方法によって得られたセラミックペ ーストを提供しようとすることである。

[0027] 【課題を解決するための手段】この発明は、まず、積層 型セラミック電子部品の製造方法に向けられる。この製 沓方法では、基本的に、次のような工程が実施される。 【0028】まず、セラミックスラリー、導電性ペース トおよびセラミックペーストがそれぞれ用意される。 【0029】次に、セラミックスラリーを成形すること によって得られたセラミックグリーンシートと、セラミ ッカグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をも たらすように部分的に導電性ペーストを付与することに よって形成された内部回路要素膜と、内部回路要素膜の 厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリ ーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成され ない領域にセラミックペーストを付与することによって 形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備え る、複数の複合構造物が作製される。

【0030】次に、これら複数の複合構造物を積み重ね ることによって、生の積層体が作製される。 【0031】そして、生の積層体が焼成される。

【0032】とのような基本的工程を備える、積層型セ

ラミック電子部品の製造方法において、この発明では、 段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラ

ミックペーストを用意する工程。すなわちセラミックペ ーストを製造する方法に特徴がある。

【0033】との発明において、セラミックペーストを 製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機 溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程

- と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機パ インダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程 程の段階において加えられることに注目すべきである。
- 【0034】また、この発明では、上述の第1の有機溶 剤以外に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第 2の有機溶剤が用いられることを特徴としている。この 第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられて も、2次分散工程の段階で加えられても、あるいは、1 次分散工程の段階で加えられながら、さらに2次分散工 程の段階で追加されてもよい。すなわち、第2の有機溶 剤は、1次混合物および/または2次混合物に含んでい
- 【0035】そして、最終的に、2次分散工程の後、2 次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤 を選択的に除去する除去工程が実施される。
- 【0036】上述したセラミックペーストの製造方法に 含まれる1次分散工程において、1次混合物は有機分散 剤を含むことが好ましい。
- 【0037】また、上述した第1の有機溶剤の20℃に おける相対蒸発速度は、100以上であり、第2の有機 溶剤の20℃における相対蒸発速度は、50以下である ことが好ましい。
- [0038]また、セラミックペーストの製造方法にお いて、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2 次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ま しい。
- 【0039】また、セラミックペーストの製造方法にお いて、有機パインダを第1の有機溶剤および/または第 2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを 作製する工程と、有機ピヒクルを濾過する工程とがさら に実施され、2次混合物は、濾過工程を経た有機ビヒク ルの状態で加えられた有機パインダを含んでいることが 40 好ましい。

【0040】また、セラミックペーストの製造方法にお いて、第1および第2の有機溶剤として、前者の相対蒸 発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合 せが選ばれるが、このことは、通常の場合、前者の沸点 が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、 容易に実現できる。

【0041】上述したような沸点の差によって第1およ び第2の有機溶剤の組合せを選択する場合。第1の有機 溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以 50 上であることが好ましい。

【0042】この発明において、セラミックグリーンシ ートを成形するために用いられるセラミックスラリー は、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するための セラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的 に同じ組成を有するセラミック粉末を含むことが好まし 41

【0043】また、この発明の特定的な実施態様におい て、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそ とが実施される。 ここで、有機バインダは、2次分散工 10 れぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、誘電体セラ ミック粉末である。との場合、内部回路要素膜が、互い の間に静電容量を形成するように配置される内部電極で あるとき、積層セラミックコンデンサを製造することが できる。

【0044】また、この発明の他の特定的な実施態様に おいて、セラミックスラリーおよびセラミックペースト にそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体 セラミック粉末である。この場合、内部同路要素護が、 コイル状に延びるコイル導体膜であるとき、積層インダ 20 クタを製造するととができる。

【0045】との発明は、また、上述したような製造方 法によって得られた。積層型セラミック電子部品にも向 けられる。

【0046】また、この発明は、上述したようなセラミ ックペーストの製造方法およびこの製造方法によって得 られたセラミックペーストにも向けられる。

[0047] [発明の実施の形態] との発明の一実施形態の説明を、

- 積層セラミックコンデンサの製造方法について行なう。 この実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方 法は、前述した図1ないし図3を参昭しながら説明する **とができる。** 
  - 【0048】この実施形態を実施するにあたり、セラミ ックグリーンシート2のためのセラミックスラリー、内 部電極1のための導電性ペーストおよび段差吸収用セラ ミックグリーン層5のためのセラミックペーストがそれ ぞれ用意される。
  - 【0049】上述のセラミックスラリーは、誘電体セラ ミック粉末、有機パインダ、可塑剤および比較的低沸点 の有機溶剤を混合することによって作製される。このセ ラミックスラリーからセラミックグリーンシート2を得 るため、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコー ティングされた、たとえばポリエステルフィルムのよう な支持体(図示せず。)上で、セラミックスラリーがド クターブレード法等によって成形され、次いで乾燥され る。セラミックグリーンシート2の各厘みは、乾燥後に おいて、たとえば数 u m とされる。

【0050】上述のようなセラミックグリーンシート2 の主面上には、複数箇所に分布するように、内部電極1 が乾燥後においてたとえば約1 umの厚みをもって形成 (6)

される。内部電極1は、たとえば、スクリーン印刷等によって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することによって形成される。この内部電極1は、それぞれ、所定の厚みを有していて、したかって、セラミックグリーンシートと上には、この厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシートとの主面上であって、内部電極1が形成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層5が成されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層5が高を10のネガティブパケーンをもって、前述したセラミックペーストとスクリーン旧野等によって付与することにより形成され、次いで乾燥される。とこで用いられるセラミックペーストは、この発明とおいて特徴となるもので、

【0052】上述した説明では、内部電極1を形成した 後に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成したが、 遊に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成した後 に内部電極1を形成するようにしてもよい。

その詳細については後述する。

[0053]上述のように、セラミックグリーンシート 20 2上に内部電極1および段差吸収用セラミックグリーン 層ちが形成された、図2に示すような複合構建物6は、 複数用意され、これら複合構造物6は、支持体より剥離 された後、適当な大きさに切断され、所定のや数だけ積 み重ねられ、きんにその上下で内部電極および段差吸収 用セラミックグリーン層が形成されていないセラミック グリーンシートを積み組むることによって、図1に一部 を示すような生役利儀化るまの作製される。

[0054]との生の簡陋体3 aは、積限方向にブレスされた後、図3に示すように、個々の積層セラミックコ 30 ンデンサのための積層体テップ4 aとなるべき大きさに切断され、次いで、脱パインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部配極が形成されることによって、積層コンデンサが学院まれる。

[0055]上述のように、段差吸収用セラミックグリーン関ちを形成することによって、回りに一部を示すように、生の程度体3 a において、内部電極 1 が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1 が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3 6 40 元まうに、指層体チェブイa において、不所望な変形が生じにくくなる。その結果、得られた積層セラミックコンデンサにおいて、デラミネーションや酸かクラック等の構造欠陥およびショート不良といった問題を生じにくくすることができる。

[0056] との発明では、段差吸収用セラミックグリーン層 を形成するためのセラミックベーストを製造する方法化特徴があり、この特徴ある製造方法を採用することにより、セラミックベーストに含まれるセラミック粉末の分散性を高めることができる。

【0057】すなわち、この発明では、セラミックペー エトを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1 の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散 工程と、この1次分散工程を能た1次温合物を少なくと も有機パインダを加えた2次混合物を分散処理する2次 粉工程とが実施される。

【0058】でのように、1次分数工程では、有機パインダを未だ加えていないので、低粘度下での分散処理を可能とし、そのため、セラミック粉末の分散性を高めることが容易である。との1次分散工程では、セラミック粉末の表面に吸着している空気が第1の有機溶剤で置換され、セラミック粉末を第1の有機溶剤で十分に添らした状態とすることができるとともに、セラミック粉末の極葉状態を十分に解除することができる。

[0059]また、2次分散工程では、上述のように、 1次分散工程で得られたセラミック粉末の高い分散性を 維持したまま、有機パインダを十分かつ均一に混合させ ることができ、また、セラミック粉末のさらなる粉砕効 果も期待できる。

0 [060] との条即では、上述の葬 1の有機溶剤以外 に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有 機溶剤も用いられる。との第2の有機溶剤は、1次分数 工程の段階で加えられても、2次分数工程の段階で加え られても、あるいは、1次分数工程の段階で加えられな がら、2次分数工程の段階でも込加投入されてもよい。 [0061]そして、最終的に、2次分数工程の後、2 次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤 が選択的に除去される。

[0082]でのように、第1の有機溶剤の除法が、2 次分散工程の後に実施されるので、2次分散工程の段階 たおいても、2次強合物の粘度を比較的底くしておくて とが可能であり、したがって、分散効率を比較的高く維 持しておくてとができるともに、前述したような2次 分散工程の段階で加えられる有機パインダの溶解性を高 めることができる。

[0063] 上述のようにして得られたセラミックペーストは、有機溶剤としては、第1の有機溶剤がわずかに 疾存することがあっても、実質的に第2の有機溶剤のみ を含んでいる。第2の有機溶剤は、第1の有機溶剤より 相対蒸発速度が小さいため、セラミックペーストの乾燥 速度を所定値以下に抑えることができ、たとえばスクリ ーン印刷を側板なく適用することを可能にする。

[0084] この発明において実施される1次分散工程 および2次分散工程では、たとえばボールミルのような メディアを用いる通常の分散処理機を適用して分散処理 することができる。

[0065]との発明において、第1の有機溶剤または 第2の有機溶剤として用いられる有機溶剤としては、種 々のものがあり、このような有機溶剤の相対蒸発速度を 50 考慮して、第1の有機溶剤として用いられるものおよび 第2の有機溶剤として用いられるものをそれぞれ選択す ればよい。

【0088】とのような有機溶剤の例としては、メチル エチルケトン、メチルイソプチルケトン、アセトン等の ケトン類、トルエン、ベンゼン、キシレン、ノルマルへ キサン等の炭化水素類、メタノール、エタノール、イソ プロバノール、ブタノール、アミルアルコール等のアル コール類、酢酸エチル、酢酸プチル、酢酸イソプチル等 のエステル類、ジイソプロビルケトン、エチルセルソル ブ、ブチルセルソルブ、セルソルブアセテート、メチル 10 を選び出すことができる。 セルソルプアセテート、プチルカルビトール、シクロへ キサノール、パイン油、ジヒドロテルビネオール、イソ ホロン、テルビネオール、シブロビレングリコール、ジ メチルフタレート等のケトン類、エステル類、炭化水素 、類、アルコール類、塩化メチレン等の塩化炭化水素類、 およびこれらの混合物が挙げられる。

【0087】より好ましくは、第1の有機溶剤として は、相対蒸発速度が100以上、さらに好ましくは15 0以上となる有機溶剤が選ばれる。除去工程での第1の 有機溶剤の除去を速やかに終えるようにするためであ る。なお、相対蒸発速度とは、比較蒸発速度とも言い、 25°Cにおける酢酸ノルマルブチル (沸点126.5 \*C) の蒸発速度を100としたときの対象とする溶剤の 相対的な蒸発速度を指す。相対蒸発速度の計算式は、 相対蒸発速度=(酢酸ノルマルブチルの蒸発時間)/ (対象溶剤の蒸発時間) ×100

となり、蒸発時間は重量法によって測定する。

【0068】第1の有機溶剤に適した相対蒸発速度が1 00以上の有機溶剤としては、たとえば、メチルエチル ン (同145)、アセトン (同720)、トルエン (同 195)、ベンゼン(同500)、メタノール(同37 0)、エタノール(同203)、イソプロパノール(同 205)、酢酸エチル(同525)、酢酸イソプチル (同152)、酢酸プチル(同100)、およびこれら の混合物が挙げられる。

【0069】他方、より好ましくは、第2の有機溶剤と しては、20℃における相対蒸発速度が50以下となる 有機溶剤が選択される。スクリーン印刷性を良好にする ためである。

【0070】第2の有機溶剤に適した相対蒸発速度が5 0以下の有機溶剤としては、たとえば、ジイソプロビル ケトン(相対蒸発速度49)、メチルセルソルプアセテ ート(同40)、セルソルブアセテート(同24)、ブ チルセルソルブ (同10)、シクロヘキサノール (同1 0以下)、パイン油(同10以下)、ジヒドロテルビネ オール (同10以下)、イソホロン (同10以下)、テ ルビネオール (同10以下)、シプロピレングリコール (同10以下)、ジメチルフタレート(同10以下).

12 合物が挙げられる。

【0071】なお、第1および第2の有機溶剤をそれぞ れ選択するにあたって、上述のように相対蒸発速度によ るのではなく、沸点によることも可能であり、むしろ沸 点による方が、第1 および第2の有機溶剤の各々の選択 が容易である。沸点による場合、第1 および第2の有機 溶剤として、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合 せを選ぶようにすれば、大体において、前者の相対蒸発 速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せ

【0072】前述した有機溶剤の例として挙げたものの いくつかについて、各々の沸点を括弧内に示すと、メチ ルエチルケトン (79.6°C)、メチルイソプチルケト ン(118.0℃)、アセトン(56.1℃)、トルエ ン(111.0℃)、ベンゼン(79.6℃)、メタノ ール (64.5°C)、エタノール (78.5°C)、イソ プロパノール (82.5°C)、酢酸エチル (77.1 ℃)、酢酸イソプチル(118、3℃)、ジイソプロビ ルケトン(143,5°C)、メチルセルソルプアセテー 20 ト(143°C)、セルソルプアセテート(156.2 °C)、ブチルセルソルブ (170、6°C)、シクロヘキ サノール (160°C)、パイン油 (195~225 \*C)、ジヒドロテルビネオール(210°C)、イソホロ ン(215.2℃)、テルビネオール(219.0 ℃)、シプロビレングリコール(231.8℃)、ジメ チルフタレート (282.4℃) となるが、このような 沸点に基づいて、第1および第2の有機溶剤をそれぞれ 選択するようにすればよい。 【0073】上述したような沸点の差によって第1およ

ケトン(相対蒸発速度465)、メチルイソプチルケト 30 び第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機 溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以 上であることが好ましい。除去工程において、加熱処理 による第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易に するためである。

> 【0074】上述した高沸点の第2の有機溶剤に関し て、スクリーン印刷性を考慮したとき、150°C以上の 沸点を有していることが好ましく、200~250°C程 度の沸点を有していることがより好ましい。 150℃未 満では、セラミックベーストが乾燥しやすく、そのた

40 め、印刷バターンのメッシュの目詰まりが生じやすく、 他方、250°Cを超えると、印刷塗膜が乾燥しにくく、 そのため、乾燥に長時間要するためである。

【0075】セラミックペーストにおいて用いられる有 機パインダとしては、室温で有機溶剤に溶解するものが 良い。このような有機パインダとしては、たとえば、ボ リビニルブチラール、ポリブチルブチラール等のポリア セタール類、ポリ (メタ) アクリル酸エステル類、エチ ルセルロース等の変性セルロース類、アルキッド類、ビ ニリデン類、ポリエーテル類、エポキシ樹脂類、ウレタ プチルカルビトール(同40以下)、およびこれらの混 50 ン樹脂類、ポリアミド樹脂類、ポリイミド樹脂類、ポリ アミドイミド樹脂類、ポリエステル樹脂類、ポリサルフ ォン樹脂類、液晶ポリマー類、ポリイミダゾール樹脂 類、ポリオキサゾリン樹脂類等がある。

【0076】有機パインダとして上に例示したポリピニルブチラールは、ポリピニルアルコールとブチルアルデヒドとの縮合とたって得られるものであり、アセチル基が62~82モル%の低重合品、中重合品および高重合品がある。この発明に係るセラミックペーストにおいて有機パインダとして用いられるポリピニルブチラールは、有機溶剤に対する溶 10解貼度および乾燥鏡原の強靭性のパランスから、ブチラール達が65年ル%程度の中重合品であることが好ましい。

[0077] 有機パインダの添加量は、セラミック粉末 に対して、1~20重量%、好ましくは、3~10重量 %に強ばれる。

[0078]上流した1次分散工程において、1次温合物は有機分散剤を含むことが好ましい。すなわち、1次温合物において、第1の有機溶剤または第1もよび第2の有機溶剤によって希釈された状態で、有機分散剤を20加すれば、セラミック粉末の分散性がより向上する。[0079]上流の有機分散剤としては、特に限定しないが、分散性の点からは、分子量は1万以下であることが好ましい。アニオン系、カチオン系、ノニオン系いずれでもよいが、ポリアクリル酸やそのアンモニウム塩、ポリアクリル酸エステル共産合体、ポリエチレンオキサイド、ポリオキシエチレンアルトルアンド、脂肪酸ジェタールアマイド、ポリエチレンイン、ボリオキシブリビレンモノアリルモノブチルエーテル、脂肪酸ジェタールアマイド、ポリエチレンイミン、ポリオキシブロビレンモノアリルモノブチルエーテルと無水マレイン酸(およびスチレン)の共産合体等が好まし 30 いた

【0080】有機分散剤の溶加量は、セラミック粉末に対して、0.1~5重量%、好ましくは、0.5~2. 0重量%に選ばれる。

[0081]また、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程がさらた実施されることが好ましい。これによって、セラミックペースト中に存在することがなる。異物、セラミック物末の凝集物、有機パインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、セラミックポ末に付着しているような添小径の空気が濾過によって破冶したり除去されたりすることにより、セラミックペーストからなる段差吸収用セラミックが同においてピンホールを減少させる効果も期待できる。

[0082] あるいは、有機パインダを第1の有機溶剤 および/または第2の有機溶剤に溶解することによっ て、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾透し た後、2次混合物において、濾過工程を経た有機ビヒク 50

ルの状態で有機パインダが加えられてもよい。
[0083]また、上述のような2つの態様の濾過は、
名々、複数回轉り返してもよく、また、2つの態様の濾 過を組み合わせてもよい。このように、濾過を複数回線 り返したり、2つの態様の濾過を組み合わせたりすることにより、濾過による効果を一層高めることができる。 [0084] 達した速速工程においては、ステンレス 鋼からなるフィルタ、またはオリプロピレン、ファ素系 樹脂等のブラスチックからなるフィルタが用いられ、滤 速速度を高めるため、空気や空素ガス等の圧縮ガスによって輪側的に難し出したり、選集ド下で吸引したりする方

[0085] また、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末は、セラミックグリーンシート2を成形するために用いられるセラミックグリーンと会まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するものであることが好まい。 段差吸収用セラミックグリーンとート2との間で焼結性を一致させるためである。

法が採用されてもよい。

20 【0088] なお、上述の実質的に同じ組成を有するとは、主成分が同じであるということである。たとえば、 鉄造版加金属酸化物やガラス等の副成分が異なっても、 実質的に同じ組成を有するということができる。また、 セラミッグリーンシート2 に含まれるセラミックが非大が、静電容量の温度特性についてJIS規格で規定する B特性およびEIA規格で規定するX7 下特性を満足す る範囲のものであれば、限金販収用セラミックグリーン 層5のためのセラミックペーストに含まれるセラミック 物末も、主成分が同じでB特性およびX7 下格性を満足 するものであれば、関めたいたらよい。

[0087]回4は、との発明の他の実施形態としての 税酬インダクタの製造方法を眺明するためのものであ り、図ちに外級を斜接図で下した、との製造方法によっ て製造された機器インダクタ11に備える機関体チップ 12を得るために用意される生の機圏体13を構成する 要素を分解して示す針拠図である。

【0088】生の積層体13は、複数のセラミックグリーンシート14、15、16、17、…、18および19を備え、これらセラミックグリーンシート14~19を積層することによって得られるものである。

[0089] セラミックグリーンシート14~19は、 磁性体セラミック粉末を含むセラミックスラリーを、ド クタープレード法等によって成形し、乾燥することによ って得られる。セラミックグリーンシート14~19の 名厚みは、乾燥後において、たとえば10~30μmと される。

【0090】セラミックグリーンシート14~19のうち、中間に位置するセラミックグリーンシート15~1 8には、以下に詳細に説明するように、コイル状に延びるコイル連体酸および反差敷収用セラミックグリーン層 が形成される。

【0091】まず、セラミックグリーンシート15上には、コイル導体膜20が形成される。コイル導体膜20は、その第1の蟾部がセラミックグリーンシート15の端縁にまで届くよう化形成される。コイル導体膜20の第20が開発には、ビアホール導体21が形成される。

【0092】とのようなコイル導体膜20およびピアホール導体21を形成するため、たとえば、セラミックグリーンシート15 にピアホール導体210ための黄連孔をレーザまたはパンチングなどの方法により形成した後、コイル導体膜20およびピアホール導体21となる導電性ペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、数様することが行なわれる。

【0094】次化、セラミックグリーンシート16上には、上述した方法と同様の方法によて、コイル導体度23、ビアホール導体24および段差級収用セラミックグリーン層26が形成される。コイル導体膜23の第1の端部は、前途したビアホール導体21を介して、コイル導体膜20の第2の端部に接続される。ビアホール導体24は、コイル導体膜20の第2の端部に形成される。

[0095]次に、セラミックグリーンシート17上には、同様に、コイル導体膜26、ビアホール場体27ま 近び段差吸収用セラミックグリーン層28が形成される。コイル場体版26の第1の端部は、前述したピアホール場体24を介して、コイル場体膜23の類2の端部 に接続される。ピアホール場体27は、コイル場体膜2 6の第2の端部に形成される。

【0096】上述したセラミックグリーンシート16および17の積層は、必要に応じて、複数回繰り返される。

【0097】次に、セラミックグリーンシート18上には、コイル導体膜29および段差吸収用セラミックグリーン層30が形成される。コイル導体膜29の類1の端部は、前途したビアホール導体27を介して、コイル導体膜26の第2の端部に接続される。コイル導体膜29は、その第2の端部が主奏きっクグリーンシート18の端線にまで届くように形成される。

【0098】なお、上述したコイル導体膜20、23、 26および29の各厚みは、乾燥後において、たとえば 約30μm程度とされる。 【0099】にのようなセラミックグリーンシート14 ~19をそれぞれ含む複数の複合構造物を積層して得ら れた生の開闢ト3年もいて、名々コイル状を延びる複 数のコイル導体膜20、23、26および29が、ピア ボール導体21、24および27を介して順次接続され るととによって、全体として複数ターンのコイル導体が 形成される。

【0100】生の積層体13が焼成されることによって、図5に示す積層インダクタ11のための積層体チッ

10 ブ12が得られる。なお、生の積層体13は、図4では、1個の積層体チップ12を得るためのものとして図示されているが、複数の積層体チップを得るためのものとして作製され、これを切断することによって、複数の積層体チップを取り出すようにしてもよい。

[0101]次いで、図5に示すように、積解体チップ 12の相対向する各端部には、前近したコイル場体膜 の第1の線部およびコイル場体膜29の第2の端部に それぞれ接続されるように、外部電極30および31が 形成され、それによって、積層インダクタ11が完成さ りる。

【0102】図1ないし図3を参照して膜明した積層を ラミックコンデンサまたは図4 および図5を参照して膜 別した預層イングタタ11において、モラミックグリー ンシート2または14~19あるいは段差吸収用セラミ ックグリーン層5または22、25、28ま比び30化 含まれるセラミック粉末としては、代表的には、アルミ ナ、ジルコニア、マグネシア、酸化チタン、チタン酸パ リウム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライト・マンプ・ プの酸化粉末セラミック粉末、炭化ケイ素、窒化ケイ 空の酸化粉末セラミック粉末、炭化ケイ素、窒化ケイ

30 素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末が挙げられる。粉末粒径としては、好ましくは、平均5μm以下、より好ましくは、1μmの球形または粉砕状のものが使用される。

【0103】また、不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量が0.1重量%以下のチタン酸バリウムをセラミック粉末として用いる場合、Cのセラミック粉末に対して、微量成分として以下のような金属酸化物やガラス成分を含有させてもよい。

[0104]金属酸化物としては、酸化テルビウム、酸 化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、酸 酸化イッテルビウム、酸化マンガン、酸化コパルト、酸 化ニッケル または酸化マグネシウム等がある。

[0 105] また、ガラス成分としては、Li, - (S iTi) O, -MO (ただし、MOはA1, O, または ZrO, )、SiO, -TiO, -MO (ただし、MO はBaO、CaO、SrO、MgO、ZnのまたはMn O)、Li, O-B, O, - (SiTi) O, +MO (ただし、MOはA1, O, またはZrO, )、B, O , -A1, O, -MO (ただし、MOはBaO、Ca

50 O、SrOまたはMgO)、またはSiO。等がある。

【0106】また。図1ないし図3を参照して説明した 精層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照 して説明した積層インダクタ11において、内部電極1 またはコイル連体障20.23.26および29ならび にピアホール連体2.1 2.4および2.7の形成のための 用いられる導電性ペーストとしては、たとえば、次のよ うなものを用いることができる。

【0107】精層セラミックコンデンサにおいて用いら れる導電性ペーストとしては、平均粒径が0.02μm ~3 um 好ましくは0.05~0.5 umであって、 Ag/Pdが60重量%/40重量%~10重量%/9 0重量%の合金からなる導電性粉末、ニッケル金属粉末 または銅金属粉末等を含み、この粉末を100重量部 と、有機パインダを2~20重量部(好ましくは5~1 0重量部)と、焼結抑制剤としてのAg、Au、Pt、 Ti.Si.NiまたはCu等の金属レジネートを金属 物質で約0.1~3重量部(好ましくは0.5~1重量 部)と、有機溶剤を約35重量部とを、3本ロールで混 練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度 調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用 20 いることができる。

【0108】積層インダクタ11において用いられる導 電性ペーストとしては、Ag/Pdが80重量%/20 重量%~100重量%/0重量%の合金またはAgから なる遺電性粉末を含み、との粉末が100重量部に対し て 上述した積層セラミックコンデンサのための導電性 ベーストの場合と同様の有機パインダと焼結抑制剤と有 機溶剤とを同様の比率で3本ロールで混練した後、同じ または別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうこ とによって得られた導電性ペーストを用いることができ 30 て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の

【0109】以下に、との発明を、実験例に基づいて、 より具体的に説明する。

#### [0110]

【実験例1】実験例1は、積層セラミックコンデンサに 関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの製造において、この発明の特徴 としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したこと による効果を確認するために実施したものである。

【0111】(セラミック粉末の準備)まず、炭酸バリ 40 ウム (BaCO, ) および酸化チタン (TiO, )を 1:1のモル比となるように秤量し、ボールミルを用い て湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、温度10 00℃で2時間仮焼した後、粉砕することによって、誘 電体セラミック粉末を得た。

【0112】(セラミックスラリーの準備およびセラミ ックグリーンシートの作製) 先に準備したセラミック粉 末100重量部と、ポリビニルブチラール(中重合品) 7重量部と、可塑剤としてDOP (フタル酸ジオクチ

タノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径 1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボー ルミルに投入し、20時間湿式混合を行なって、セラミ ックスラリーを得た。

【0113】そして、とのセラミックスラリーに対し て、ドクタープレード法を適用して、厚さ3μm (焼成 後の厚みは2μm) のセラミックグリーンシートを成形 した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0114】 (漢雪性ペーストの進備) Ag/Pd=3 0/70の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4 重量部と、アルキッド樹脂2 重量部と、Ag金属レジ ネート3 重量部 (Agとして17.5重量部)と、ブチ ルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロール で混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度 調整を行なった。

【0115】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックベーストの準備) -試料1-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部 と 直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、 ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次 に、同じポットに、沸点220°Cのテルビネオール (相 対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース 樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合するこ とによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0116】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60 Cの温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し

ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0117】-試料2-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、テルビネオール30重 量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220°Cのテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0118】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60°Cの温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0119】-試料3-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ ル) 3 重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エ 50 チルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級ア ンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220°Cのテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0120】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し 10 て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

#### [0121]-試料4-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、沸 点220℃のテルピネオール40重量部と、エチルセル ロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本 ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。 【0122】(積層セラミックコンデンサの作製)先に

用意したセラミックグリーンシートの主面上に内部電極 20 を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、 80°Cで10分間乾燥した。なお、内部電極の寸法、形 状および位置は、後の工程で得られる積層体チップに適 合するように設定した。次に、セラミックグリーンシー トの主面上に段差吸収用セラミックグリーン層を形成す るため、試料1ないし4に係る各セラミックペーストを スクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。内部電 極および段差吸収用セラミックグリーン層の各厚みは、 乾燥後において、1 µm (焼成後の厚みは0.5 µm) になるようにした。

【0123】次に、上述のように内部電極および段差吸 収用セラミックグリーン層を形成している200枚のセ ラミックグリーンシートを、内部電極等が付与されてい ない数10枚のセラミックグリーンシートで挟み込むよ うに積み重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、 80℃で1000Kg/cm2の加圧条件で熱プレスし tc.

[0124]次に、焼成後において長さ3、2mm×幅 6 mm×厚み1、6 mmの寸法となるように、上述 の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数 40 の積層体チップを得た。

【0125】次に、ジルコニア粉末が少量散布された焼 成用セッタートに、上述の複数の積層体チップを整列さ せ、室温から250℃まで24時間かけて昇温させ、有 機バインダーを除去した。次に、積層体チップを、焼成 炉に投入し、最高1300°Cで約20時間のプロファイ ルにて焼成を行なった。

【0126】次に、得られた焼結体チップをバレルに投 入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に外部電極

[0127] (特性の評価)上述した試料1ないし4に 係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデン サについて、各種特性を評価した。その結果が表 1 に示 されている。 [0128]

【表1】

試料番号	1	2	3	4
面形分(wt%)	65	64	66	67
粘度(Pars)	9	8	10	12
分散度	0	0	-0.2	0.3
印刷厚み(µm)	4	4	3	5
Ra(µm)	0.5	0.5	0.3	1.5
構造欠陰不良率(%)	2.	3	0	80

- 【0129】表1における特性評価は、次のように行な った。
- 【0130】「固形分1:セラミックペースト約1gを 精秤し、熱対流式オープンにおいて、150℃で3時間 放置した後の重量から算出した。
- 【0131】「粘度」:セラミックペーストの粘度を、 東京計器製E型粘度計を用いて、20℃において、2. 5 r pmの回転を付与して測定した。
- 【0132】「分散度」:セラミック粉末の粒度分布を 光回折式粒度分布測定装置を用いて測定し、得られた粒 度分布から算出した。すなわち、先に準備したセラミッ ク粉末を、 超音波ホモジナイザーを用いて水中で分散さ せ、粉経がこれ以上小さくならないところまで超音波を 印加し、そのときのD90の粒経を記録して、これを限 界粒経とした。他方、セラミックペーストをエタノール 30 中で希釈し、粒度分布のD90の粒経を記録して、これ をペーストの粒経とした。そして、

分散度= (ペーストの約経/限界粒経)-1 の式に基づき、分散度を算出した。この分散度は、数値 が+であれば、値が0に近いほど、分散性が良いことを 示し、数値が-であれば、絶対値が大きいほど、分散性 が良いことを示している。

【0133】「印刷厚み」:96%アルミナ基板上に、 400メッシュで厚み50 µmのステンレス鋼製スクリ ーンを用いて、乳剤厚み20μmで印刷し、80℃で1 0分間乾燥するととにより、評価用印刷塗膜を形成し、 その厚みを、比接触式のレーザ表面組さ計による測定結 果から求めた。

【0134】「Ra (表面粗さ)」:上記「印刷厚み」 の場合と同様の評価用印刷塗膜を形成し、その表面粗さ Ra. すなわち、うねりを平均化した中心線と粗さ曲線 との偏差の絶対値を平均化した値を、比接触式のレーザ 表面粗さ計による測定結果から求めた。

【0135】「構造欠陥不良率」: 得られた積層セラミ ックコンデンサのための焼結体チップの外観検査、超音 を設けて、試料となる積層セラミックコンデンサを完成 50 波顕微鏡による検査で異常が見られた場合、研磨により 内部の構造欠陥を確認し、(構造欠陥のある焼結体チッ ブ数)/(焼結体チップの総数)を構造欠陥不良率とし

【0136】表1を参照すれば、1次分散工程と2次分 散工程とを採用し、2次分散工程において有機パインダ を添加した、試料1~3によれば、このようなことを行 なわなかった試料4に比べて、優れた分散性を得るとと ができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良 率の各項目においても優れた結果を示していることがわ かる。

#### [0137]

- 【実験例2】実験例2は、上記実験例1と同様、積層セ ラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用 セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製 造において、濾過工程を付加したことによる効果を確認 するために実施したものである。
- 【0138】以下の段差吸収用セラミックグリーン層の ためのセラミックペーストの進備工程を除いて、前述し た実験例1と同様の工程を実施して、積層セラミックコ ンデンサを作製した。
- 【0139】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの準備)
- -試料5-
- 実験例1における試料1の場合と同様の操作を経て得ら れたセラミックスラリー混合物を、絶対減過20 um
- (99. 7%の確率で10 um以上のものを除去でき る)のフィルタによって加圧下で濾過した。
- 【0140】その後、実験例1における試料1の場合と 同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を 処理して、セラミックペーストを得た。
- 【0141】-試料6-

上記試料5の場合において実施された絶対濾過20μm のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過1μm のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試 料5の場合と同様の操作を実施して、セラミックペース トを得た。

沸点220℃のテルビネオール40重量部と、メチルエ チルケトン10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量 部とを、プラネタリーミキサーにて混合することによっ て. エチルセルロース樹脂をテルビネオールおよびメチ ルエチルケトンに溶解させた有機ビヒクルを作製し、こ の有機ピヒクルを絶対濾過20μmのフィルタによって 加圧下で濾過したものを用意した。

22

【0143】他方、先に準備した誘電体セラミック粉末 10 100重量部と、メチルエチルケトン60重量部と 直 径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボール ミルに投入し、16時間混式混合を行なった。

【0144】次に、同じポットに、前述のように予め用 意された濾過後の有機ビヒクルを加え、さらに、16時 間混合することによって、セラミックスラリー混合物を 得た。

【0145】その後、実験例1における試料1の場合と 同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を 処理して、セラミックペーストを得た。

[0146]-試料8-

\* [0142] - 試料7-

上記試料7の場合において実施された絶対濾過20 um のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過 1 μm のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試 料7の場合と同様の操作を実施して、セラミックペース トを得た。

[0147]-賦料9-

試料7の場合において実施された操作に加えて、試料5 の場合において実施されたセラミックスラリー混合物の 濾過をさらに実施することによって、セラミックベース 30 トを得た。

【0148】上述した試料5ないし9に係るセラミック ペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各 種特性を評価した結果が、表2に示されている。 [0149]

【表2】

放料番号	5	6	7	8	9
面形分(wt%)	66	67	66	67	68
粘度(Pa+s)	10	12	15	14	16
分散度、	-0.1	-0.2	0	0	-0.3
印刷厚み(µm)	3	2	3	2	2
Ra(µm)	0.4	0,3	0.6	0.5	0.2
構造欠陥不良率(%)	1.5	1	1.5	1	0

【0150】表2における特件評価方法は、表1の場合 と同様である。

- 【0151】表2における試料5は、表1における試料 1 と比較して、セラミックスラリー混合物を濾過してい る点でのみ異なっているので、試料5を試料1と比較す れば、濾過による効果を確認することができる。すなわ
- 性を得ることができ、また、印刷原み、表面組さおよび 構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示して いる。
- 【0152】また、表2において、試料5と試料6との 比較、試料7と試料8との比較、あるいは、試料5また は7と試料9との比較をそれぞれ行なうと、濾過工程に ち、試料5によれば、試料1に比べて、より優れた分散 50 関して、これを複数回行なったり、異なる態様の濾過を

組み合わせたりすることにより、濾過による効果を一層 高め得ることがわかる。

[0153]

【実験例3】実験例3は、上記実験例1 および2 と同様、親層セラミックコンデンサに関するものであるが、 段差吸収用セラミックリーン層のためのセラミックペ ーストの製造において用いられる第1 および第2 の有機 治剤の各々についての相対発発速度の好ましい範囲を確 認するために実施したものである。

【0154】以下に記載する、段差吸収用セラミックグ 10 リーン層のためのセラミックベーストの準備工程を除い て、前述した実験例1と同様の工程を実施して、積層セ ラミックコンデンサを作製した。

【0155】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備) - 試料10-

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が100の酢酸ノルマルブチルを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0156】-試料11-

\*実験例1 における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が720のアセトンを用いたことを 除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミック ペーストを作製した。

24

【0157】-試料12-

実験例1 における試料1 と比較して、第1の有機溶剂と して、相対張発速度が83のイソブチルアルコールを用 いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、 セラミックベーストを作割した。

10 【0158】-試料13-

「取りる」であれています。 実験例になける試料1と比較して、第1の有機溶剤と して、相対漂発速度が370のメタノールを用い、かつ、第2の有機溶剤として、相対漂発速度が55のメチ ルセルソルケを用いたことを除いて、試料10場合と同 値の操作を経て、セラミックペーストを作製した。 【0159】上述した試料10ないし13に係名セラミ ックペーストおよび積層セラミックコンデンザについ

Ψ [#12]

		* [	教31	
試料當号	10	11	12	13
第1の有機溶剤 (相対凝発速度)	許融/ルマルプテル (100)	アセトン (720)	イソフ・チルアルコール (83)	メタノール (370)
第2の有機溶剤 (相対薬発速度)	テルビネオール (10以下)	テルビネオール (10以下)	テルビネオール (10以下)	メチルセルソルブ (55)
蒸発時間(Hr)	2	'	4	蒸発がいつまでも 止まらない
国影分(wt%)	70	67	68	_
粘度(Pa-s)	15	9	10	_
分散度	0.2	0	0.4	_
Ra(µm)	0.7	0.5	1.0	
構造欠陥不良率(%)	3	2	10	_

【0161】表3において、「蒸発時間」は、減圧蒸留 開始時から有機溶剤(道常、第1の有機溶剤)が蒸発し なくなるまでの時間を示したものである。表3における その他の特性についての評価方法は、表1の場合と同様 である。

[0182]表3を参照して、第1の有機治剤として、 相対蒸発速度が100以上のものを用い、かつ、第2の 有機治剤として、相対蒸光速度が50以下のものが用い 40 られた、試料10および11によれば、第1の有機治剤 の蒸発を迅速に終えることができるとともに、分散性、 表面祖さおよび構造欠陥不良率の点でも好ましい結果を 得ることができる。

[0163] にれた対して、第2の有機諮詢の相対蒸発速 速度は50以下であるが、第1の有機諮詢の相対蒸発速 度が100未満である。試料12では、第1の有機諮詢 を迅速に蒸発させることができず、また、分散性、表面 程さればて構造欠陥不良等の点においても、試料10お よび11に化っておっている。 【0164】また、第1の有機溶剤の相対蒸発速度は1 00以上であるが、第2の有機溶剤の相対蒸発速度が5 0を超える。近射13では、第2の有機溶剤についての 蒸発が長時間続き、たとえば、スクリーン印刷を実施し ている間にセラミックペーストの乾燥が進むため、スク リーンの目詰まり等を生じ、良好なスクリーン印刷を速 成することが困難になる。

[0165]

【実験例4】実験例4は、積層インダクタに関するもの で、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミッ クペーストの製造において、この発明の特徴としての1 次分散工程と2次分散工程とを採用したことによる効果 を確認するために実施したものである。

[0166] (セラミック粉末の準備) 酸化第二鉄が4 9.0モル%、酸化亜鉛が29.0モル%、酸化ニッケルが14.0モル%、本よび酸化解が8.0モル%となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、

50 脱水乾燥させた。次いで、750°Cで1時間仮焼した

後、粉砕することによって、磁性体セラミック粉末を得 た.

【0167】(セラミックスラリーの準備およびセラミ ックグリーンシートの作製) 先に進備した磁性体セラミ ック粉末100重量部と、ポリピニルブチラール(中重 合品) 7重量部と、可塑剤としてDOP (フタル酸ジオ クチル) 3重量部と、メチルエチルケトン30重量部 と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部と を、直径1mmのジルコニア製玉石600電量部ととも に、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なっ て、セラミックスラリーを得た。

【0168】そして、とのセラミックスラリーに対し て、ドクターブレード法を適用して、厚さ20μm (焼 成後の厚みは15μm)のセラミックグリーンシートを 成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0169】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=7 0/30の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、Ag金属レジ ネート3 重量部 (Agとして17、5重量部) と、ブチ ルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロール 20 動乳鉢により分散・調整した。 で混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度 調整を行なった。

【0170】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの進備)

#### -試料14-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部 と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次 対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース 樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合すると とによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0171】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60°Cの温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

#### 【0172】-試料15-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、テルビネオール30重 量部と、直径1 mmのジルコニア製玉石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間混式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220°Cのテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0173】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60°Cの温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸 50 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述

留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックベーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

26

【0174】-試料16-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級ア ンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部 10 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220°Cのテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0175】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60°Cの温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自

【0176】-試料17-先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、沸 点220°Cのテルビネオール40重量部と、エチルセル ロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本 ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0177】(精層インダクタの作制)複数の磁性体セ ラミックグリーンシートの精層後にコイル状に延びるコ イル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラ ミックグリーンシートの所定の位置に、ピアホール導体 に、同じポットに、沸点220°Cのテルビネオール(相 30 のための貫通孔を形成するとともに、磁性体セラミック グリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内 にピアホール導体を形成するため、導電性ペーストをス クリーン印刷し、80°Cで10分間乾燥した。次に、磁 性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体 セラミックグリーン層を形成するため、試料14ないし 17に係る各磁性体セラミックペーストをスクリーン印 刷し、80°Cで10分間乾燥した。コイル導体障および 段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各層みは、乾 燥後において、30 um (焼成後の厚みは20 um) に

40 なるようにした。 【0178】次に、上述のようにコイル導体膜およびビ アホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層 を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシー トを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラ ミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、 この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧下 で勢ブレスした。

【0179】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅

後、粉砕することによって、磁性体セラミック粉末を得 た。

【0167】(セラミックスラリーの準備およびセラミ ックグリーンシートの作製) 先に準備した研性体セラミ ック粉末100重量部と、ポリビニルブチラール (中重 合品) 7重量部と、可塑剤としてDOP (フタル酸ジオ クチル) 3重量部と、メチルエチルケトン30重量部 と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部と を、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部ととも に、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なっ て、セラミックスラリーを得た。

【0168】そして、このセラミックスラリーに対し て、ドクタープレード法を適用して、厚さ20μm (焼 成後の厚みは15μm)のセラミックグリーンシートを 成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0169】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=7 0/30の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、Ag金属レジ ネート3重量部 (Agとして17.5重量部) と プチ ルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロール 20 で混練した後、テルピネオール35重量部を加えて粘度 調整を行なった。

【0170】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの準備)

#### -試料14-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部 と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、 ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次 に、同じポットに、沸点220°Cのテルビネオール (相 30 対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース 樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合するこ とによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0171】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

#### 【0172】-試料15-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と メ チルエチルケトン70重量部と、テルビネオール30重 量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0173】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60°Cの温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸 50 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述

留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

### 【0174】-試料16-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル砂4級ア ンモニウム塩分散剤 (重量平均分子量1000) 0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部 10 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0175】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60 ℃の温浴中でエバボレータにより2 時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

### 【0176】-試料17-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、沸 点220℃のテルビネオール40重量部と、エチルセル ロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本 ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0177】(積層インダクタの作製)複数の磁性体セ ラミックグリーンシートの積層後にコイル状に延びるコ イル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラ ミックグリーンシートの所定の位置に、ピアホール導体 のための貫通孔を形成するとともに、磁性体セラミック グリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内 にピアホール導体を形成するため、導電性ペーストをス クリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。次に、磁 性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体 セラミックグリーン層を形成するため、試料14ないし 17に係る各磁性体セラミックペーストをスクリーン印 刷し、80℃で10分間乾燥した。コイル導体膜および 段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の名厚みは、乾 爆後において、30μm (焼成後の厚みは20μm) に 40 なるようにした。

【0178】次に、上述のようにコイル導体膜およびビ アホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層 を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシー トを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに、 その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラ ミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し この積層体を、80℃で1000Kg/cm2の加圧下 で熱プレスした。

【0179】次に、焼成後において長さ3、2mm×幅

の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数 の積層体チップを得た。

- [0180]次に、上述の積層体チップを400℃で2 時間加熱するととによって、有機パインダを除去した 後、900°Cで90分間の焼成を行なった。
- 【0181】次に、得られた焼結体チップをバレルに投 入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に主成分が 銀である外部電極を設けて、試料となるチップ状の積層 インダクタを完成させた。
- 【0182】(特性の評価)上述した試料14ないし1 10 7 に係るセラミックペーストおよび積層インダクタにつ いて、各種特性を評価した結果が表4に示されている。 [0183]

【表4】

試料番号	14	15	16	. 17
周影分(wt%)	72	73	72	73
粘度(Pa·s)	15	14	17	18
分散度	0	0	-0.3	0.2
印刷厚み(µm)	20	21	19	19
Ra(µm)	0.5	0.5	0.2	1.6
構造欠陥不良率(%)	1	1	0	50

【0184】表4における特性評価方法は、表1の場合 と同様である。

【0185】表4を参照すれば、表1に示した実験例1 の場合と同様、1次分散工程と2次分散工程とを採用 し、2次分散工程において有機パインダを添加した、試 料14~16によれば、このようなことを行なわなかっ た試料17に比べて、優れた分散性を得ることができ、 また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項 目においても優れた結果を示していることがわかる。 【0186】以上、この発明に係るセラミックペースト に含まれるセラミック粉末として、誘電体セラミック粉 末または磁性体セラミック粉末が用いられる場合につい て説明したが、この発明では、用いられるセラミック粉

末の電気的特性に左右されるものではなく、したがっ て、たとえば、絶縁体セラミック粉末あるいは圧電体セ ラミック粉末等を用いても、同様の効果を期待できるセ ラミックペーストを得ることができる。

### [0187]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、セラ 40 ミックペーストを製造するにあたって、少なくともセラ ミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散 処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合 物に少なくとも有機パインダを加えた2次混合物を分散 処理する2次分散工程と、第1の有機溶剤より相対蒸発 速度が小さい第2の有機溶剤を1次混合物および/また は2次混合物に含ませる工程と、2次分散工程の後、2 次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤 を選択的に除去する除去工程とが実施されるので、セラ

れたものとすることができる。そのため、極めて薄いセ ラミックグリーン層を、高いパターン精度をもって形成 しなければならない場合において、このようなセラミッ クペーストを有利に用いることができる。

【0188】したがって、この発明によれば、積層型セ ラミック電子部品において、内部回路要素膜の厚みによ る段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシー トの主面上であって内部同路要素膜が形成されない領域 に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するために、 上述のようなセラミックペーストが用いられることによ って、クラックやデラミネーション等の構造欠陥のない 信頼性の高い積層型セラミック電子部品を実現すること ができる。

【0189】また、この発明によれば、積層型セラミッ ク電子部品の小型化かつ軽量化の要求に十分に対応する ととが可能となり、この発明が積層セラミックコンデン サに適用された場合。 積層セラミックコンデンサの小型 化かつ大容量化を有利に図ることができ、また、この発 明が積層インダクタに適用された場合、積層インダクタ 20 の小型化かつ高インダクタンス化を有利に図ることがで

【0190】上述した1次分散工程において、1次混合 物に有機分散剤を含ませるようにすると、セラミック粉 末の分散性をより向上させることができる。

【0191】また、上述した第1の有機溶剤の20℃に おける相対蒸発速度が100以上とされ、第2の有機溶 剤の20℃における相対蒸発速度が50以下とされる と、除去工程での第1の有機溶剤の除去を速やかに終え ることができるとともに、スクリーン印刷性を良好にす 30 るととができる。

【0192】また、2次分散工程の後であって、除去工 程の前に、2次混合物を濾過する工程をさらに実施した り、 有機パインダを第1の有機溶剤および/または第2 の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作 製し、との有機ビヒクルを濾過した後、2次混合物に含 ませるようにしたりすれば、セラミックペースト中に存 在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有 機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分 **贄性の高いセラミックベーストを確実に得ることができ** る。また、焼成後のセラミック層においてピンホールを 減少させる効果も期待できる。

[0193]また、第1および第2の有機溶剤として、 前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくな るような組合せを選ぶため、前者の沸点が後者の沸点よ り低くなる組合せを選ぶようにすれば、第1および第2 の有機溶剤の選択が容易になる。

【0194】上述したような沸点の差によって第1およ び第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機 溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差を、50°C以 ミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を優 50 上とすることにより、除去工程において、加熱処理によ

29

る第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易にする ととができる。 【0195】また、この発明に係る積層型セラミック電

【0 195】また、この発明に係る積層型セラミック電子部品の製造方法において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーが、段差吸収用セラミックグリーン開を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むようにすると、セラングリーントと段差吸収用セラミックグリーン 層との機結性を一致させることができ、このような焼結 10性の不一致によるクラックやデラミネーションの発生を 防止することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】との発明にとって興味ある、かつこの発明の一 実施形態による、積層セラミックコンデンサの製造方法 を説明するためのもので、生の積層体3 a の一部を図解 的に示す断面図である。

【図2】図1 に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される複合構造物6の一部を破断して 示す平面図である。

【図3】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される積層体チップ4 a を図解的に示す断面図である。

【図4】 この発明の他の実施形態による積層インダクタ を製造するために用意される生の積層体13を構成する\* \*要素を分解して示す斜視図である。

【図5】図4に示した生の積層体13を焼成して得られ た積層体チップ12を備える積層インダクタ11の外観 を示す斜視関である。

【図6】 この発明にとって興味ある従来の積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の積層体3の一部を図解的に示す斯面図である。

【図7】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される内部電極1が形成されたセラミ ックグリーンシート2の一部を示す平面図である。

【図8】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4を図解的に示す 断面図である。

# 【符号の説明】

1 内部電極(内部回路要素膜)

2, 14~19 セラミックグリーンシート

3a, 13 生の積層体 4a, 12 積層体チップ

5,22,25,28,30 段差吸収用セラミックグ 20 リーン層

6 複合構造物

11 積層インダクタ(積層型セラミック電子部品)20,23,26,29 コイル導体膜(内部回路要素

[E1] (E2) (E3) (E4)

(E5) (E6)

(E7)

(E7)

特開2001-237140

[図8]



フロントページの続き

		_				
(51)Int.C1.'		識別記号	FΙ		2-42-}.	(参考)
C 0 4 B	35/622		H01F	41/04	C	
H01F	17/00		H 0 1 G	4/30	3 0 1 E	
	41/04				3 1 1 F	
H01G	4/30	301	C04B	35/00	J	
		3 1 1			D	